# UVM-1 全光谱显微镜

UVM-1TM全光谱显微镜（UV-visible-NIR microscope）的设计是将紫外和近红外成像技术和宽带显微技术相结合，能够完美的实现紫外-可见-近红外的成像。具有前沿技术的UVM-1TM显微镜结合了CRAIC公司创新设计的光学技术，用户仅用一台显微镜就能在整个宽光谱范围内完成显微成像。无论高分辨率，还是光谱成像能力，UVM-1TM都代表显微成像领域的最高水平。

具有独特的多功能性系统设计能够允许用户只在一台显微镜上获得紫外-可见-近红外的高分辨率成像和分析结果。紫外显微镜对半导体内微量异物有很高的灵敏性，相比标准的显微镜，具有更强大的能力解决细节变化；而近红外显微镜能够无损的、有选择性的对硅晶片设备内部的电子电路进行精确成像。这些应用只是其众多应用领域的一小部分，UVM-1TM全光谱显微镜灵活的设计使其在任何应用领域都能做到完美、最优秀。

UVM-1TM使用独特创新的光学设计，并配有高分辨能力的数字相机和高放大倍数的显微镜，能够在全光谱范围内获得高品质和高分辨率的彩色成像。UVM-1TM全光谱显微镜堪称是一款强大、独一无二的显微光谱分析工具。

|  |  |
| --- | --- |
| 显微镜光谱范围 | 200-2500nm |
| 透射图像 | 可用 |
| 荧光激发 | 254-546nm |
| 反射成像系统 | 可用 |
| 偏振成像 | 可用 |
| 视图范围 | 40-2400微米 |
| 高分辨率紫外成像 | 可用 |
| 高分辨率近红外成像 | 可用 |
| 紫外-可见-近红外目标 | 可用 |
| 冷固态传感器 | 可用 |
| 显微镜自动化 | 可用 |



